

儀器設備介紹

設備名稱	高真空濺鍍系統之改裝
設備廠商/型號	60113-27 Q270-1
規 格	
<p>主要功能為金屬、金屬氧化物與金屬氮化物，靶材直徑 76.2mm。規格有以下幾種。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 有真空系統，可以到 10^{-6}torr。2. 具有加熱系統，在濺鍍製程中做加熱3. 電源供應系統可分為 RF 與 DC 兩種電流源4. 真空偵測器，分為 $760\sim 10^{-2}$torr 與 $10^{-2}\sim 10^{-7}$torr 兩種偵測範圍。	
功 能	
<ol style="list-style-type: none">1. 真空腔體製造腔體內真空環境2. 抽氣系統，腔體內壓力可抽至 10^{-6}torr3. 電源供應系統，分為 DC 與 RF 源4. 濺鍍電極為外加磁場的陰極可作為靶材濺鍍之用。	
圖 片	

